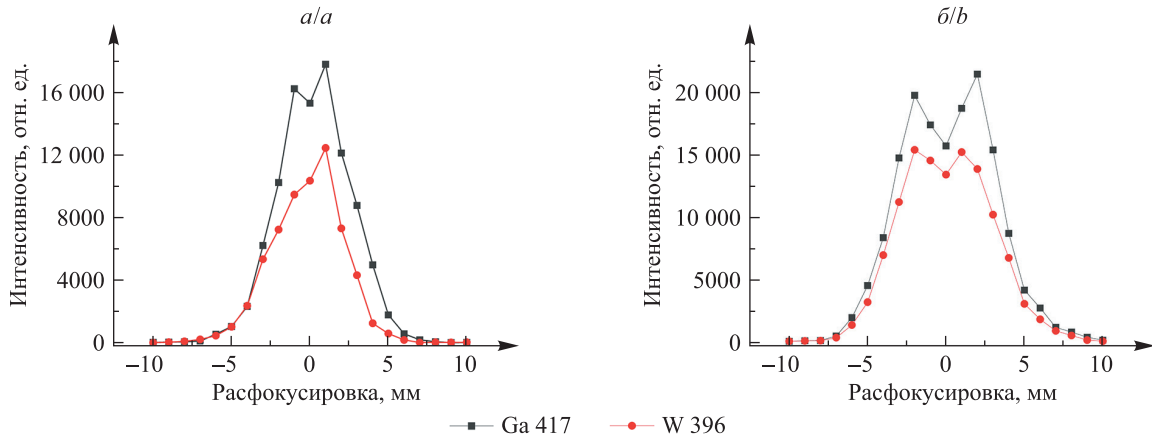




*Рис. 3.* Зависимость интенсивности спектральных линий Ga 417 и W 396 от расстояния расфокусировки при лазерной абляции галлия на вольфрамовой подложке:  
*а* – одноимпульсная лазерная абляция (межимпульсный интервал 0 мкс);  
*б* – двухимпульсная лазерная абляция (межимпульсный интервал 10 мкс)

*Fig. 3.* Dependence of the intensity of the spectral lines Ga 417 and W 396 on the defocusing distance during laser ablation of gallium on a wolfram substrate:  
*a* – single-pulse laser ablation (interpulse interval 0  $\mu$ s);  
*b* – double-pulse laser ablation (interpulse interval 10  $\mu$ s)